

В. П. Житников, Р. Р. Муксимова

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКИМ ЭЛЕКТРОД-ИНСТРУМЕНТОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ НЕРОВНОСТЬЮ

Задачи моделирования нестационарного электрохимического формообразования сводятся к решению двух краевых задач для определения аналитических функций комплексного переменного: конформного отображения параметрической плоскости на физическую и частных производных по времени координат точек межэлектродного пространства. Каждая из функций ищется в виде суммы известной функции с особенностями и двух неизвестных функций, определяемых с помощью интеграла Шварца. Одна из неизвестных функций предназначена для описания неровности электрода-инструмента, вторая – обрабатываемой поверхности. Представлены результаты численного решения задач с электродом в виде сегмента круга и пластины. *Нестационарное формообразование; аналитические функции; установление стационарных конфигураций*

ВВЕДЕНИЕ

Для решения задач нестационарной электрохимической обработки применяются методы конечных [1] и граничных [2–4] элементов. При этом, как отмечается в [4], применение численных методов, как правило, затрудняется неустойчивостью, в особенности при исследовании длительных процессов и при обработке электрод-инструментами (ЭИ), имеющими острые кромки. Это приводит к необходимости разработки новых методов, обладающих улучшенными свойствами.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ФОРМУЛИРОВКА КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ

Рассмотрим нестационарную задачу электрохимического формообразования с помощью ЭИ, представляющего собой плоскость с выступом или впадиной с горизонтальным размером R (рис. 1). ЭИ заглубляется в заготовку со скоростью V_{et} под прямым углом к поверхности. Начальный межэлектродный зазор (МЭЗ) равен S_0 .

В результате растворения происходит сдвиг точек анодной границы, причем каждая из ее точек движется со своей скоростью $V_{ecm} \sim \frac{dW}{dz}$.

Асимптотическая величина зазора $S(t)$ изменяется и на бесконечности слева и справа приближается к стационарной величине

$$S_{st} = \frac{kk_I \eta U}{V_{et}}, \quad (1)$$

где k – электрохимическая постоянная; k_I – коэффициент, учитывающий средний ток за период (с учетом скважности импульсов и изменения свойств среды); η – выход по току. При этом $V_{et} = V_{ecm}^{st}$.

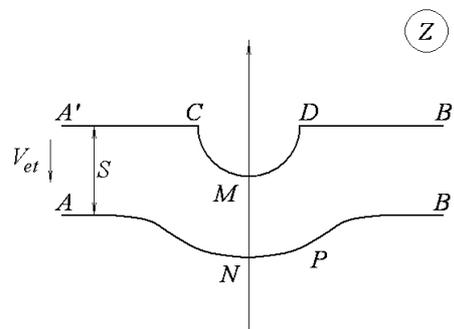


Рис. 1. Схема МЭП на физической плоскости

Задачи удобнее решать в безразмерном виде. Сведение к безразмерным величинам для данной задачи проведем следующим образом. В качестве характерного размера выберем величину стационарного зазора (1), который устанавливается при обработке (при обработке поверхности с горизонтальной асимптотой эта величина зазора устанавливается на бесконечности слева и справа).

Перейдем к безразмерным величинам z , x , y , τ и w , где

$$z = \frac{Z}{S_{st}}, \quad x = \frac{X}{S_{st}}, \quad y = \frac{Y}{S_{st}}, \quad (2)$$

$$\tau = \frac{V_{et}}{S_{st}} t = \frac{kk_I \eta U}{S_{st}^2} t, \quad w = \frac{W}{U}.$$

Контактная информация: (347) 273-32-00

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президента «Ведущие научные школы РФ» (проект НШ-65497.2010.9).

Тогда

$$v_{et} = -\frac{dy_{A'}}{d\tau} = -\frac{1}{S_{st}} \frac{S_{st}}{V_{et}} \frac{dY_{A'}}{dt} = \frac{V_{et}}{V_{et}} = 1, \tag{3}$$

$$v_{ecm} = -\frac{dy_A}{d\tau} = \frac{S_{st}}{S(t)} = \frac{1}{s(\tau)}.$$

При этом согласно (3) значение $s(\tau)$ должно удовлетворять следующим условиям:

$$s = s_0 - \tau + \int_0^\tau v_{ecm}(\tau_1) d\tau_1 = s_0 - \tau + \int_0^\tau \frac{1}{s(\tau_1)} d\tau_1, \tag{4}$$

$$\frac{ds}{d\tau} = -1 + \frac{1}{s(\tau)}$$

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

В связи с эквипотенциальностью электродов форма области МЭП на плоскости комплексного потенциала представляет собой полосу (рис. 2).

Выберем в качестве параметрической переменную $\chi = \sigma + iv$, область изменения которой представляет собой горизонтальную полосу единичной ширины (рис. 3, а). Конформное отображение параметрической плоскости χ на плоскость комплексного потенциала определяется по формуле $W = Ui\chi$.

Тогда согласно (2)

$$w = \varphi + i\psi = i\chi, \quad \frac{dw}{d\chi} = i, \quad \frac{\partial\psi}{\partial\sigma} = 1. \tag{5}$$

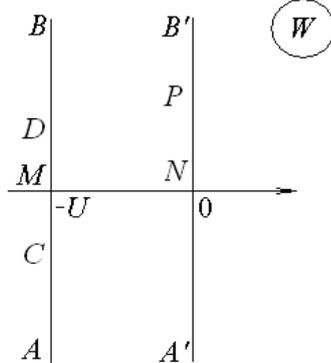


Рис. 2. Форма образа МЭП на плоскости комплексного потенциала

Представим функцию, конформно отображающую полосу плоскости χ на область МЭП физической плоскости в неподвижной (относительно тела заготовки) системе координат в виде суммы

$$z(\chi, \tau) = -i \int_0^\tau \frac{d\tau_1}{s(\tau_1)} + s(\tau)\chi + z_a(\chi, \tau) + z_c(\xi(\chi), \tau), \tag{6}$$

где $z_a(\chi, \tau)$ – аналитическая в области D_χ и непрерывная в ее замыкании \bar{D}_χ функция, опре-

деляющая отличие формы обрабатываемой поверхности от прямолинейной (при $\chi = \sigma + i \text{Im } z_a(\chi, \tau) = 0$); $z_c(\xi, \tau)$ – аналитическая в области D_ξ и непрерывная в ее замыкании \bar{D}_ξ функция, предназначенная для описания выпуклости на ЭИ (при $\xi = \omega + i0 \text{Im } z_c(\xi, \tau) = 0$). Функция $z_c(\xi, \tau)$ определена на полосе единичной ширины D_ξ (рис. 3, б). Связь ξ и χ

$$\chi = \frac{1}{\pi} \ln \frac{e^{\pi\xi} e^{\pi\beta} - 1}{e^{\pi\xi} - e^{\pi\beta}} + i, \quad \xi = \frac{1}{\pi} \ln \frac{1 + e^{\pi\chi} e^{\pi\beta}}{e^{\pi\chi} + e^{\pi\beta}}. \tag{7}$$

Производные при $\chi = \sigma$

$$\frac{d\xi}{d\chi} = \frac{e^{\pi\sigma} (e^{2\pi\beta} - 1)}{(1 + e^{\pi\sigma} e^{\pi\beta})(e^{\pi\sigma} + e^{\pi\beta})}, \tag{8}$$

$$\frac{\partial\xi}{\partial\tau} = \frac{e^{\pi\beta} (e^{2\pi\sigma} - 1)}{(1 + e^{\pi\sigma} e^{\pi\beta})(e^{\pi\sigma} + e^{\pi\beta})} \frac{d\beta}{d\tau}.$$

При $\xi = \omega + i$

$$\frac{d\xi}{d\chi} = \frac{(1 + e^{\pi\omega} e^{\pi\beta})(e^{\pi\omega} + e^{\pi\beta})}{e^{\pi\omega} (e^{2\pi\beta} - 1)}, \tag{9}$$

$$\frac{\partial\xi}{\partial\tau} = -\frac{e^{\pi\beta} (e^{2\pi\omega} - 1)}{e^{\pi\omega} (e^{2\pi\beta} - 1)} \frac{d\beta}{d\tau}.$$

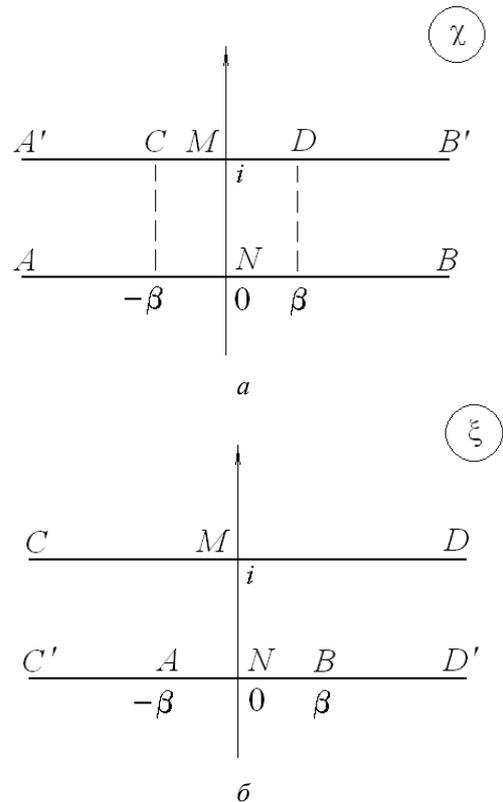


Рис. 3. Формы образов МЭП на параметрических плоскостях χ и ξ

В силу (6), поскольку горизонтальный размер неровности ЭИ $r = \text{Re } z_D$,

$$r = \frac{R}{S_{st}} = s(\tau)\beta(\tau) + z_c(\infty, \tau) + z_a(\beta(\tau) + i, \tau), \quad (10)$$

где $\beta(\tau)$ – образ точки D , определяемый из этого уравнения. Из уравнения, получаемого дифференцированием (10), найдем производную

$$\frac{d\beta}{d\tau} = - \frac{\frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\beta(\tau) + i, \tau) + \frac{\partial}{\partial \tau} z_c(\infty, \tau) + \beta(\tau) \left(-1 + \frac{1}{s(\tau)} \right)}{s(\tau) + \frac{\partial z_a}{\partial \chi}(\beta(\tau) + i, \tau)}. \quad (11)$$

Функция $z_a(\chi, \tau)$ определяется следующим образом. Будем искать решение на границе $\chi = \sigma + i0$ в узловых точках σ_m ($m = 0, \dots, n$). Заданными на каждом временном шаге будут значения $\text{Im } z_a(\sigma_m, \tau_j) = y_m$. Примем $\text{Im } z_a(\sigma_n, \tau) = 0$, поскольку $z_a(\sigma, \tau)$ быстро (как экспонента) убывает при $\sigma \rightarrow \infty$. Значения $\text{Im } z_a(\sigma, \tau)$ в промежуточных между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна, имеющего две непрерывные производные.

Для восстановления функции $z_a(\chi, \tau)$ используем формулу Шварца с учетом того, что $z_a(\chi, \tau)$ аналитическая функция, имеющая чисто действительные значения на прямой $\text{Im } \chi = 1$, и $\text{Im } z_a(\sigma, \tau) = \text{Im } z_a(-\sigma, \tau)$

$$z_a(\chi, \tau) = \text{sh } \pi \chi \int_0^{\infty} \text{Im } z_a(\sigma, \tau) \frac{d\sigma}{\text{ch } \pi \sigma - \text{ch } \pi \chi}. \quad (12)$$

Производная $\text{Im } \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(\sigma, \tau) = -\text{Im } \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(-\sigma, \tau)$,

тогда

$$\frac{dz_a}{d\chi}(\chi, \tau) = \int_0^{\infty} \text{Im } \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(\sigma, \tau) \frac{\text{sh } \pi \sigma}{\text{ch } \pi \sigma - \text{ch } \pi \chi} d\sigma. \quad (13)$$

Функция $z_c(\xi, \tau)$ получается аналогичным образом. Будем искать решение на границе $\xi = \omega + i$ в узловых точках ω_m ($m = 0, \dots, n$). Заданными будут значения $\text{Im } z_c(\omega_m, \tau_j) = \bar{y}_m$. Примем $\text{Im } z_c(\omega_n, \tau) = 0$. Для восстановления функции $z_c(\xi, \tau)$ используем формулу Шварца с учетом того, что $z_c(\xi, \tau)$ аналитическая функция, имеющая чисто действительные значения на прямой $\text{Im } \xi = 0$, и $\text{Im } z_c(\omega + i, \tau) = \text{Im } z_c(-\omega + i, \tau)$

$$z_c(\xi, \tau) = \text{sh } \pi \xi \int_0^{\infty} \text{Im } z_c(\omega + i, \tau) \frac{d\omega}{\text{ch } \pi \omega + \text{ch } \pi \xi}. \quad (14)$$

Производная

$$\frac{\partial z_c}{\partial \xi}(\xi, \tau) = - \int_0^{\infty} \text{Im } \frac{\partial z_c}{\partial \omega}(\omega + i, \tau) \frac{\text{sh } \pi \omega}{\text{ch } \pi \omega + \text{ch } \pi \xi} d\omega. \quad (15)$$

3. АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ

Нестационарная задача сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений и решается численным методом. При этом на каждом временном шаге $\tau_j = j\Delta\tau$, $j = 1, 2, \dots, k$ решаются задачи конформного отображения полосы параметрической плоскости χ на физическую плоскость z . При этом задача конформного отображения в полном объеме решается только при $\tau = 0$. Значения переменных $y_m(\tau_{j+1})$ и $\bar{y}_m(\tau_{j+1})$ на следующем шаге по времени вычисляются с помощью частных производных $\frac{\partial y_a}{\partial \tau}(\sigma_m, \tau_j)$, $\frac{\partial y_c}{\partial \tau}(\omega_m, \tau_j)$. Частные производные по времени определяются при решении краевой задачи: найти частную производную $\frac{\partial z}{\partial \tau}(\chi, \tau_j)$ как аналитическую функцию комплексного параметра χ , удовлетворяющую краевому условию [5]

$$\text{Im} \left(\frac{\partial \bar{z}}{\partial \sigma} \frac{\partial z}{\partial \tau} \right) = -\text{Im} \frac{\partial w}{\partial \sigma}. \quad (16)$$

Для вычисления производной $\frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\chi, \tau_j)$

применяется способ, аналогичный применяемому для определения конформного отображения $z_a(\chi, \tau_j)$. Искомыми параметрами на каждом временном шаге $\tau_j = j\Delta\tau$ будут значения $\text{Im } \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\sigma_m, \tau_j) = q_m$. Значения $\text{Im } \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\sigma, \tau_j)$ в промежуточных между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна $Q(\sigma, \tau)$.

Для восстановления $\frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\chi, \tau_j)$ используем формулу Шварца, аналогичную (12):

$$\frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\chi, \tau) = \text{sh } \pi \chi \int_0^{\infty} Q(\sigma, \tau) \frac{d\sigma}{\text{ch } \pi \sigma - \text{ch } \pi \chi}. \quad (17)$$

Для вычисления производной $\frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\xi, \tau_j)$

также применяется способ, аналогичный применяемому для определения конформного отображения $z_c(\xi, \tau_j)$. Искомыми параметрами на каждом временном шаге $\tau_j = j\Delta\tau$ будут значения $\text{Im } \frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\omega_m, \tau_j) = r_m$. Значения $\text{Im } \frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\omega, \tau_j)$ в промежуточных между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна $R(\omega, \tau)$.

Для восстановления $\frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\xi, \tau_j)$ используем формулу Шварца, аналогичную (14):

$$\frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\xi, \tau) = \text{sh } \pi \xi \int_0^{\infty} R(\omega, \tau) \frac{d\omega}{\text{ch } \pi \omega + \text{ch } \pi \xi}. \quad (18)$$

С учетом (3)–(9) определяются производные $\frac{\partial z}{\partial \sigma}, \frac{\partial z}{\partial \tau}$ при $\chi = \sigma + i0$ (на границе анода)

$$\frac{\partial z}{\partial \sigma}(\sigma, \tau) = s(\tau) + \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(\sigma, \tau) + \frac{\partial z_c}{\partial \xi}(\xi(\sigma), \tau) \frac{\partial \xi}{\partial \sigma}, \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial \tau}(\sigma, \tau) = & -\frac{i}{s(\tau)} + \left(-1 + \frac{1}{s(\tau)}\right)\sigma + \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\sigma, \tau) + \\ & + \frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\xi(\sigma), \tau) + \frac{\partial z_c}{\partial \xi}(\xi(\sigma), \tau) \frac{\partial \xi}{\partial \tau}. \end{aligned} \quad (20)$$

На границе катода $\xi = \omega + i$ в системе координат, связанной с катодом,

$$z_{et}(\chi, \tau) = -is(\tau) + s(\tau)\chi + z_a(\chi, \tau) + z_c(\xi(\chi), \tau).$$

С учетом (3), (4) производные

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_{et}}{\partial \sigma}(\sigma + i, \tau) = \\ = s(\tau) + \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(\sigma + i, \tau) + \frac{\partial z_c}{\partial \sigma}(\xi(\sigma + i), \tau), \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_{et}}{\partial \tau}(\sigma + i, \tau) = & \left(-1 + \frac{1}{s(\tau)}\right)\sigma + \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\sigma + i, \tau) + \\ & + \frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\xi(\sigma + i), \tau) + \frac{\partial z_c}{\partial \xi}(\xi(\sigma + i), \tau) \frac{\partial \xi}{\partial \tau}. \end{aligned} \quad (22)$$

Для вычисления $\frac{d\beta}{d\tau}$ (11) найдем производные

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\beta(\tau) + i, \tau) = \\ = -\text{sh } \pi \beta(\tau) \int_0^{\infty} \text{Im} \frac{\partial z_a}{\partial \tau}(\sigma, \tau) \frac{d\sigma}{\text{ch } \pi \sigma + \text{ch } \pi \beta(\tau)}, \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_a}{\partial \chi}(\beta(\tau) + i, \tau) = \\ = \int_0^{\infty} \text{Im} \frac{\partial z_a}{\partial \sigma}(\sigma, \tau) \frac{\text{sh } \pi \sigma}{\text{ch } \pi \sigma + \text{ch } \pi \beta(\tau)} d\sigma, \end{aligned} \quad (24)$$

$$\frac{\partial}{\partial \tau} z_c(\infty, \tau) = \int_0^{\infty} \text{Im} \frac{\partial z_c}{\partial \tau}(\sigma + i, \tau) d\sigma. \quad (25)$$

Значения q_m, r_m определяются методом коллокаций по краевому условию (16) с учетом (19), (20) и того, что $\psi = \sigma$ (5),

$$\text{Im} \left[\frac{\partial z}{\partial \tau}(\sigma_m) \overline{\frac{\partial z}{\partial \sigma}(\sigma_m)} \right] + 1 = 0, \quad m = 0, \dots, N - 1. \quad (26)$$

На катоде краевое условие с учетом (21), (22) имеет вид

$$\text{Im} \left[\frac{\partial z_{et}}{\partial \tau}(\omega_m) \overline{\frac{\partial z_{et}}{\partial \sigma}(\omega_m)} \right] = 0, \quad m = 0, \dots, N - 1. \quad (27)$$

После решения системы линейных алгебраических уравнений (26), (27) и определения частных производных $\text{Im} \frac{\partial z_a}{\partial \tau} = q_m, \text{Im} \frac{\partial z_c}{\partial \tau} = r_m$ производится шаг по времени по методу предиктор-корректор второго порядка точности.

Далее снова повторяется процесс вычисления $\frac{\partial z_a}{\partial \chi}, \frac{\partial z_c}{\partial \xi}, q_m, r_m$ и т. д.

4. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Численные результаты представлены на рис. 4–7. На рис. 4 показаны формы поверхности при обработке полукруглым ЭИ с радиусом $r = 10$. Картина в системе координат, связанной с подвижной асимптотической поверхностью анода (рис. 4, а), показывает ход процесса растворения и позволяет увидеть установление стационарной формы обрабатываемой поверхности (которая была рассчитана заранее).

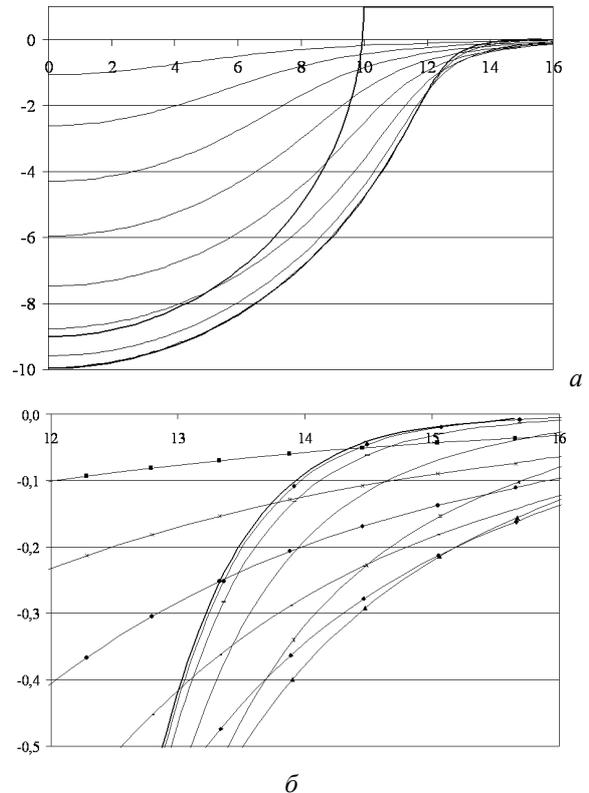


Рис. 4. Формы поверхности при обработке полукруглым ЭИ с радиусом $r = 10$ и шагом по времени $\Delta\tau = 2$: а – основная часть поверхности; б – фрагмент обрабатываемой поверхности вблизи излома ЭИ

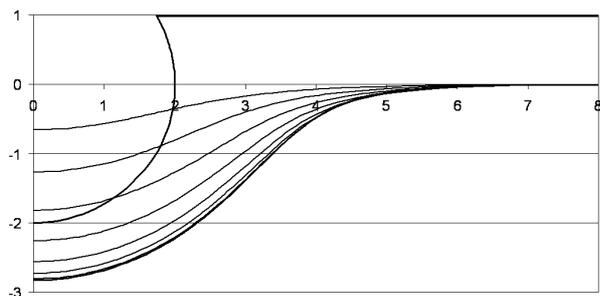


Рис. 5. Формы поверхности при обработке ЭИ в форме сегмента с радиусом $r = 2$ и с высотой $l = 3$ с шагом по времени $\Delta\tau = 1$

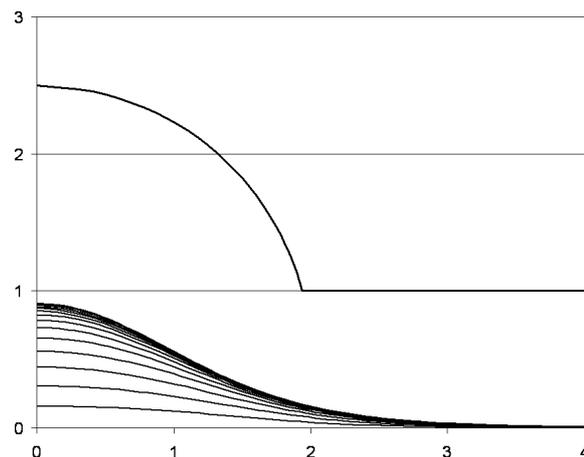
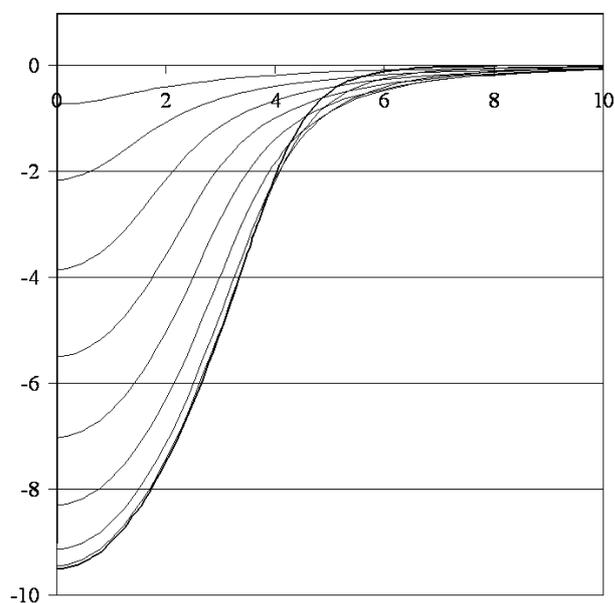
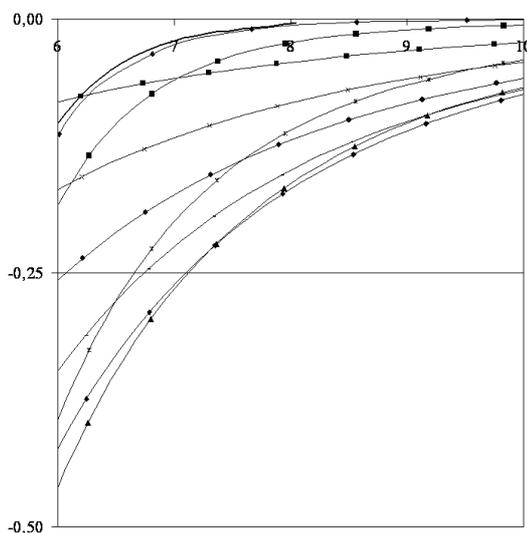


Рис. 6. Формы поверхности при обработке ЭИ с выемкой с радиусом $r = 2$ с шагом по времени $\Delta\tau = 1$



a



б

Рис. 7. Формы поверхности обрабатываемой ЭИ в форме вертикальной пластины с высотой $l = 10$ с шагом по времени $\Delta\tau = 2$: *a* – основная часть поверхности; *б* – фрагмент обрабатываемой поверхности

Разработанный метод позволяет рассматривать ЭИ с выступом и впадиной, форма которых может варьироваться в широких пределах. В частности, на рис. 7 рассмотрен ЭИ в виде горизонтальной пластины, присоединенной к плоскому основанию.

На рис. 5 и 6 показаны формы нестационарной обрабатываемой поверхности при обработке ЭИ, имеющего выпуклость и впадину в форме сегмента круга. Во всех случаях наблюдается установление стационарной формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе предложен численно-аналитический метод решения задач нестационарной электрохимической обработки при помощи плоского электрода-инструмента с выступом или выемкой криволинейной формы, основанный на аналитическом решении задачи определения частных производных координат по времени и разделении функций, определяющих неровности ЭИ и обрабатываемой поверхности. Рассмотрение численных примеров подтвердило высокую эффективность предложенного метода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Электрохимическое формообразование в условиях локальной изоляции анодной поверхности. I. Теоретический анализ / А. Н. Мустянце [и др.] // Электронная обработка материалов. Кишинев: Штиинца. 1989. № 3. С. 11–15.
2. **Котляр Л. М., Минзетдинов Н. М.** Эволюция формы анодной границы при электрохимической размерной обработке металлов // Прикладная механика и техническая физика. Новосибирск. 2004. Т. 45, № 4. С. 7–12.
3. **Volgin V. M., Davydov A. D.** Modeling of multistage electrochemical shaping // Journal of Materials Processing Technology. Elsevier. 2004. Vol. 149, No 1-3 4. P. 466–471.
4. 3D electrochemical machining computer simulations / M. Purcar [et al.] // Journal of Materials Processing Technology. Elsevier. 2004. Vol. 149, No 1–3. P. 472–478.
5. **Житников В. П., Зайцев А. Н.** Математическое моделирование электрохимической размерной обработки. Уфа: УГАТУ, 1996. 221 с.

ОБ АВТОРАХ

НЕТ ДАННЫХ!